

# 広島大学・山口大学 合同シンポジウム

**日時** 平成22年8月27日(金) 13:00~17:30

**場所** 広島大学霞キャンパス 広仁会館

広島県広島市南区霞1-2-3  
(広島駅より「大学病院行」バス乗車、「大学病院前」下車。  
所要時間約20分、学内徒歩約5分)

**主催** 広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所  
山口大学産学公連携・イノベーション推進機構



## プログラム

13:00 ~ 13:05	開会の挨拶		横山 新 広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所教授
13:05 ~ 13:55	基調講演	MEMSの概要および技術動向	江刺 正喜 東北大学大学院工学研究科ナノメカニクス専攻教授
13:55 ~ 14:40	基調講演	Current Trends in Manufacturing and Metrology of Microfabricated Sensors and Actuators	David A. Horsley Professor, Berkeley Sensor & Actuator Center University of California, Davis
休憩			
14:50 ~ 15:35	基調講演	磁性薄膜形成プロセスと真空装置	樽松 保美 キヤノンアネルバ(株) 事業統括部門 事業戦略室 エキスパート
15:35 ~ 15:55	成果報告	極薄SiNx膜を用いた薄膜トランジスタの低温領域における電気特性	小林 孝裕 兵庫県立大学大学院工学研究科博士課程後期学生
15:55 ~ 16:15	成果報告	シリコンフォトリソ技術の実現に向けた温度無依存化技術	上沼 睦典 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 助教
休憩			
16:25 ~ 16:45	成果報告	次世代向けレジスト材料の開発	奥村 有道 ダイセル化学工業(株) 研究統括部コーポレート研究所主任研究員
16:45 ~ 17:05	成果報告	強磁性半導体を用いたトンネル磁気接合素子の作製	仙波 伸也 宇部工業高等専門学校准教授
17:05 ~ 17:25	成果報告	真空新材料チタンの真空高性能な表面処理技術開発	石澤 克修 三愛プラント工業(株) クリーンテック事業本部技術開発センター長
17:25 ~ 17:30	閉会の挨拶		山本 節夫 山口大学産学公連携・イノベーション推進機構 教授

**申込**

Webでお申し込みください。登録無料。(当日参加も受け付けますが、できるだけ事前登録をお願いします)  
<http://www.nanonet.hiroshima-u.ac.jp/modules/eguide/event.php?eid=7>

**お問合せ**

広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所  
電話：082(424)6265  
Eメール：nanotech@hiroshima-u.ac.jp

山口大学産学公連携・イノベーション推進機構  
電話：0836(85)9950  
Eメール：nanotech@yamaguchi-u.ac.jp

**懇親会**

懇親会も予定しております(霞会館にて会費1500円)。皆様のご参加をお待ちいたしております。